

## MEMS研究開発拠点 装置一覧

2026年4月1日現在

| No. | 装置番号    | 施設等名称              | 備考                |          |       |
|-----|---------|--------------------|-------------------|----------|-------|
|     |         |                    | 試料寸法              | 設置場所     | 用途    |
| 1   | MEMS001 | ウェハディップ洗浄装置        | 200mm/300mm       | TKB812-F | 処理    |
| 2   | MEMS002 | ウェハスピンド洗浄装置        | 200mm/300mm       | TKB812-F | 処理    |
| 3   | MEMS003 | 有機ドラフト             | 300mm 以下          | TKB812-F | 処理    |
| 4   | MEMS004 | 異方性ウェットエッチング装置     | 200mm             | TKB812-F | 加工    |
| 5   | MEMS005 | IPA ベーパー乾燥機        | 200mm             | TKB812-F | 処理    |
| 6   | MEMS006 | i-線ステッパ            | 200mm             | TKB812-F | 加工    |
| 7   | MEMS007 | マスク露光装置            | 200mm             | TKB812-F | 加工    |
| 8   | MEMS008 | マスクレス露光装置          | 500mm 角以下         | TKB812-F | 加工    |
| 9   | MEMS010 | 光学顕微鏡              | 300mm 以下          | TKB812-F | 分析・評価 |
| 10  | MEMS011 | Si 酸化膜プラズマCVD 装置   | 200mm/300mm       | TKB812-F | 加工    |
| 11  | MEMS012 | スパッタ               | 200mm             | TKB812-B | 加工    |
| 12  | MEMS013 | 酸化炉                | 200mm             | TKB812-F | 加工    |
| 13  | MEMS015 | Si 窒化膜減圧CVD 装置     | 200mm             | TKB812-F | 加工    |
| 14  | MEMS016 | ポリ Si 減圧 CVD 装置    | 200mm             | TKB812-F | 加工    |
| 15  | MEMS017 | 金属膜ドライエッチング装置      | 200mm             | TKB812-F | 加工    |
| 16  | MEMS018 | Si 酸化膜ドライエッチング装置   | 200mm             | TKB812-F | 加工    |
| 17  | MEMS019 | 8"Si 深掘ドライエッチング装置  | 200mm             | TKB812-F | 加工    |
| 18  | MEMS020 | 12"Si 深掘ドライエッチング装置 | 300mm             | TKB812-F | 加工    |
| 19  | MEMS021 | 犠牲層ドライエッチング装置      | 100/150/200mm     | TKB812-F | 加工    |
| 20  | MEMS022 | アッシャー              | 300mm 以下          | TKB812-F | 加工    |
| 21  | MEMS023 | 光学検査顕微鏡            | 200mm 以下          | TKB812-F | 分析・評価 |
| 22  | MEMS024 | 段差測定器              | 200mm 以下          | TKB812-F | 分析・評価 |
| 23  | MEMS025 | エリブソメーター           | 200mm 以下          | TKB812-F | 分析・評価 |
| 24  | MEMS026 | 膜厚測定器              | 200mm 以下          | TKB812-F | 分析・評価 |
| 25  | MEMS027 | ウェハ塵埃検査装置          | 200mm             | TKB812-F | 分析・評価 |
| 26  | MEMS028 | 干渉型表面形状評価装置        | 200mm 以下          | TKB812-F | 分析・評価 |
| 27  | MEMS029 | シート抵抗プローバー         | 200mm 以下          | TKB812-F | 分析・評価 |
| 28  | MEMS030 | 赤外線レーザ顕微鏡          | 200mm 以下          | TKB812-F | 分析・評価 |
| 29  | MEMS031 | レーザ顕微鏡             | 200mm 以下          | TKB812-F | 分析・評価 |
| 30  | MEMS032 | ブレードダイサー           | 300mm 以下          | 2A-CR    | 加工    |
| 31  | MEMS033 | レーザステルスダイサー        | 200mm 以下          | 2A-CR    | 加工    |
| 32  | MEMS034 | 光学顕微鏡              | 300mm 以下          | 2A-CR    | 分析・評価 |
| 33  | MEMS036 | 電子ビーム/抵抗蒸着装置       | 200mm             | TKB812-B | 加工    |
| 34  | MEMS037 | 熱処理装置              | 200mm             | TKB812-B | 加工    |
| 35  | MEMS038 | チップ to ウェハ接合装置     | 100/150/200/300mm | TKB812-B | 加工    |
| 36  | MEMS039 | ウェハ to ウェハ接合装置     | 100/150/200mm     | TKB812-B | 加工    |
| 37  | MEMS041 | 光表面処理装置            | 200mm             | TKB812-B | 処理    |
| 38  | MEMS042 | 12"ウェハ常温接合装置       | 100/150/200/300mm | 3F-CR    | 加工    |
| 39  | MEMS043 | 測長 SEM             | 200mm             | TKB812-B | 分析・評価 |

|    |         |                          |                    |          |       |
|----|---------|--------------------------|--------------------|----------|-------|
| 40 | MEMS044 | 分析 SEM                   | 300mm 以下           | TKB812-B | 分析・評価 |
| 41 | MEMS045 | 超音波顕微鏡                   | 300mm 以下           | TKB812-B | 分析・評価 |
| 42 | MEMS046 | 赤外線顕微鏡                   | 200mm 以下           | TKB812-B | 分析・評価 |
| 43 | MEMS047 | 薄膜応力評価装置                 | 100/125/150/200 mm | TKB812-B | 分析・評価 |
| 44 | MEMS048 | X 線 CT 評価装置              | 300mm 以下           | TKB812-B | 分析・評価 |
| 45 | MEMS049 | テスタープローバー                | 200mm 以下           | TKB812-B | 分析・評価 |
| 46 | MEMS050 | 光学顕微鏡                    | 300mm 以下           | TKB812-B | 分析・評価 |
| 47 | MEMS051 | 圧電薄膜評価装置                 | 100-200mm          | 3H-CR    | 分析・評価 |
| 48 | MEMS053 | ダイシエータスタ                 | 100mm 以下           | TKB812-B | 分析・評価 |
| 49 | MEMS058 | 無機ドラフト                   | 300mm 以下           | TKB812-F | 処理    |
| 50 | MEMS059 | レジスト塗布現像装置               | 200mm              | TKB812-F | 分析・評価 |
| 51 | MEMS060 | イオンミリング装置                | 200mm 以下           | TKB812-B | 加工    |
| 52 | MEMS069 | 自動光学顕微鏡                  | 200mm 以下           | TKB812-F | 分析・評価 |
| 53 | MEMS070 | レーザードップラー測定器             | 200mm 以下           | TKB812-B | 分析・評価 |
| 54 | MEMS071 | フーリエ変換赤外分光装置             | 200mm 以下           | TKB812-F | 分析・評価 |
| 55 | MEMS072 | 小口径スパッタ                  | 100mm 以下           | TKB812-B | 分析・評価 |
| 56 | MEMS073 | マニュアルプローバ                | 200mm 以下           | TKB812-B | 分析・評価 |
| 57 | MEMS074 | ダイシングフィルム貼付装置            | 200mm 以下           | 2A-CR    | 加工    |
| 58 | MEMS075 | 保護フィルム貼付装置               | 200mm 以下           | TKB812-F | 加工    |
| 59 | MEMS076 | フォトリソ工程用オープン             | 200mm 以下           | TKB812-F | 加工    |
| 60 | MEMS077 | 2流体洗浄装置                  | 200mm 以下           | 3F-CR    | 処理    |
| 61 | MEMS078 | リフトオフ装置                  | 200mm 以下           | TKB812-F | 加工    |
| 62 | MEMS079 | レーザーマーカー                 | 200mm 以下           | TKB812-F | 処理    |
| 63 | MEMS080 | チップソーター                  | 200mm 以下           | TKB812-B | 加工    |
| 64 | MEMS081 | 高速シリコン深掘り装置              | 200mm 以下           | 2E-CR    | 加工    |
| 65 | MEMS082 | 高速酸化膜ICPエッチング装置          | 200mm 以下           | 2E-CR    | 加工    |
| 66 | MEMS083 | 金属膜ICPエッチング装置            | 200mm 以下           | 2E-CR    | 加工    |
| 67 | MEMS084 | 汎用RIE装置                  | 200mm 以下           | 2E-CR    | 加工    |
| 68 | MEMS085 | 低温対応酸化膜・窒化膜CVD装置         | 200mm 以下           | 2E-CR    | 加工    |
| 69 | MEMS086 | 高荷重フリップチップボンダー           | 100mm角 以下          | 2E-CR    | 加工    |
| 70 | MEMS087 | ピコ秒レーザー加工機               | 200mm角 以下          | 2E-CR    | 加工    |
| 71 | MEMS088 | イナートオープン                 | 200mm角 以下          | 2E-CR    | 処理    |
| 72 | MEMS089 | 酸素プラズマバレル型アッシャー          | 150mm 以下           | 2E-CR    | 加工    |
| 73 | MEMS090 | 水蒸気プラズマ対応アッシャー           | 200mm角 以下          | 2E-CR    | 加工    |
| 74 | MEMS091 | 両面スクラブ・二流体・メガソニックウエハ洗浄装置 | 200mm 以下           | 2E-CR    | 処理    |
| 75 | MEMS092 | 高解像度4Kデジタルマイクロスコープ       | 300mm 以下           | 2E-CR    | 分析・評価 |
| 76 | MEMS093 | 裏面对応高速レーザー直描装置           | 200mm角 以下          | 2E-CR    | 加工    |
| 77 | MEMS094 | 裏面对応コンタクトアライナ            | 100mm 以下           | 2E-CR    | 加工    |
| 78 | MEMS095 | 青色レーザー顕微鏡                | 300mm 以下           | 2E-CR    | 分析・評価 |
| 79 | MEMS096 | セミオートコーター・デベロッパー         | 200mm 以下           | 2E-CR    | 加工    |
| 80 | MEMS097 | HMDS処理装置                 | 200mm 以下           | 2E-CR    | 処理    |
| 81 | MEMS098 | スプレーコーター                 | 200mm角 以下          | 2E-CR    | 加工    |

|    |         |                      |           |       |       |
|----|---------|----------------------|-----------|-------|-------|
| 82 | MEMS099 | 光学干渉式膜厚計             | 300mm 以下  | 2E-CR | 分析・評価 |
| 83 | MEMS100 | 触針式段差計               | 100mm 以下  | 2E-CR | 分析・評価 |
| 84 | MEMS101 | 電界放出形電子顕微鏡           | 100mm 以下  | 2E-CR | 分析・評価 |
| 85 | MEMS102 | 冷却イオンミリング装置          | 小片        | 2E-CR | 加工    |
| 86 | MEMS103 | オスミウムコーター            | 100mm 以下  | 2E-CR | 加工    |
| 87 | MEMS104 | マニュアルへき開装置           | 200mm 以下  | 2E-CR | 加工    |
| 88 | MEMS105 | 赤外線顕微鏡               | 100mm 以下  | 2E-CR | 分析・評価 |
| 89 | MEMS106 | マニュアルボールボンダー         | 小片        | 2E-CR | 加工    |
| 90 | MEMS107 | マニュアルウェッジワイヤーボンダー    | 小片        | 2E-CR | 加工    |
| 91 | MEMS108 | マニュアルダイボンダー          | 小片        | 2E-CR | 加工    |
| 92 | MEMS109 | 25MHz3次元レーザードップラー振動計 | 200mm角 以下 | 2E-CR | 分析・評価 |
| 93 | MEMS110 | 白色干渉式形状観察装置          | 200mm角 以下 | 2E-CR | 分析・評価 |
| 94 | MEMS111 | 半導体パラメータアナライザ        | —         | 2E-CR | 分析・評価 |
| 95 | MEMS112 | パリレンコーター             | 200mm角 以下 | 2E-CR | 加工    |
| 96 | MEMS113 | 膜応力測定装置              | 200mm 以下  | 2E-CR | 分析・評価 |
| 97 | MEMS114 | RF-DCスパッタ装置          | 200mm 以下  | 2E-CR | 加工    |
| 98 | MEMS115 | ギ酸リフロー装置             | 200mm角 以下 | 2E-CR | 加工    |
| 99 | MEMS116 | 真空ラミネーター             | 200mm 以下  | 2A-CR | 加工    |